

半導体用特殊材料ガス/高純度・超高純度キャリアガス供給用

A

② 1段減圧式

最大流量: 50ℓ, 150ℓ/min. (標準状態)

1次圧力: 3.0MPa以下, 調整圧力: 0.1~1.0MPa

Heリーク値:

 $5 \times 10^{-11} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec.}$ 以下

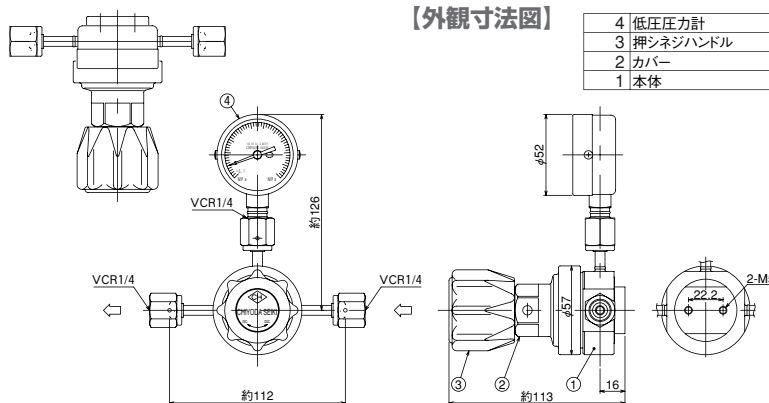
III

エクセレント・メガ・シリーズ (電解研磨品)

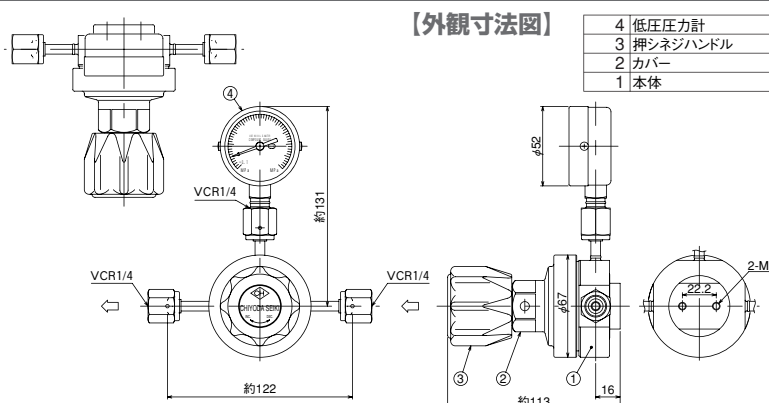
EX-M-500/EX-M-600...MR (認定品) シリーズ



EX-M-500



EX-M-600



【特長】

- 外部リーク $5 \times 10^{-11} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec.}$ 以下の超機密構造。
- パーティクルを極限まで抑えた、超清浄仕上げ。
- 超清浄処理を行った圧力計 (クリーンM) を使用。
(接ガス部は、全てEP (電解研磨・VCR継手込み) 処理を施しております。)

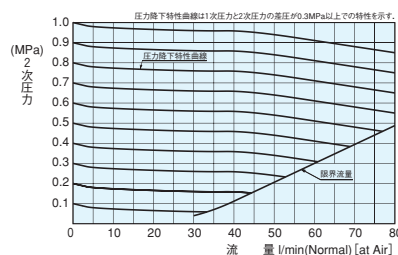
【用途】

- 超LSI製造用高純度ガスの供給システム。
- 超高純度ガス, 混合ガスの供給システム。
- 超清浄度, 超高純度を必要とする各種ガスシステム。

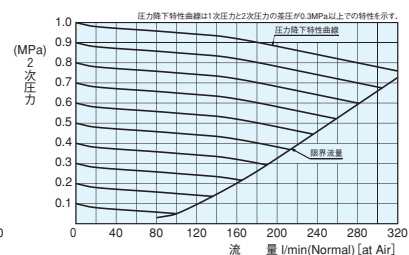
【パネル取付】

- パネル孔: φ36.5mm
- パネル板厚: 4.5mm以下
- 取付ナット対辺: 41mm

【EX-M-500型 流量表】



【EX-M-600型 流量表】



【標準仕様】

仕様	型式	EX-M-500	EX-M-600
認定品		MR-EX-M-500	MR-EX-M-600
グレード		M	M
適用ガス		超高純度ガス	超高純度ガス
材質	本体 ダイヤフラム シート	SUS316L-EP (電解研磨) 処理 SUS316-EP (電解研磨) 処理 SUS316L-EP (電解研磨) 処理	SUS316L-EP (電解研磨) 処理 SUS316-EP (電解研磨) 処理 SUS316L-EP (電解研磨) 処理
1次圧力		3.0MPa以下	
調整圧力		0.1~1.0MPa	
標準流量		0~20ℓ/min (標準状態)	0~100ℓ/min (標準状態)
最大流量		50ℓ/min (標準状態)	150ℓ/min (標準状態)
最大CV値		0.17	
使用温度		-10~+60℃	
露点温度		-74℃以下	
He外部リーク値		$5 \times 10^{-11} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$ 以下	
1次圧力計		なし	
2次圧力計		-0.1~0.6MPa (尚、ご使用圧力により選択いたします。)	
入口接続		VCR1/4 (EP)	VCR1/4 (EP) VCR3/8 (EP)
出口接続		VCR1/4 (EP)	VCR1/4 (EP) VCR3/8 (EP)
本体質量		1.2kg	1.3kg

認定品仕様 - MRシリーズ

御注文時に下記項目をご指定下さい

型式・流体名

右高圧/左高圧

1次/2次設計圧力

1次/2次圧力計

入口/出口継手形状

I 一般工業ガス用
圧力調整器II 分析用標準ガス・
理科実験器用
圧力調整器III 半導体用特殊材料ガス
高純度・超高純度
キャリアガス用圧力調整器IV 一般工業ガス
供給設備・機器V 分析用標準ガス
供給設備・機器VI 半導体用特殊材料ガス
高純度・超高純度
キャリアガス供給設備・機器

VII 大臣認定品として

VIII 高圧ガスの法律

IX 参考資料